

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成27年5月28日(2015.5.28)

【公開番号】特開2013-218126(P2013-218126A)

【公開日】平成25年10月24日(2013.10.24)

【年通号数】公開・登録公報2013-058

【出願番号】特願2012-88871(P2012-88871)

【国際特許分類】

G 09 F 9/30 (2006.01)

G 02 F 1/1345 (2006.01)

G 02 F 1/1368 (2006.01)

【F I】

G 09 F 9/30 330 Z

G 02 F 1/1345

G 02 F 1/1368

【手続補正書】

【提出日】平成27年4月8日(2015.4.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の画素がマトリクス状に形成された表示領域を有するTFT基板と、

異方導電フィルムによって前記TFT基板に接続されたICドライバと、を有する表示装置であって、

前記TFT基板には、前記ICドライバと接続された複数のIC用端子が第1のピッチにて形成され、

前記複数のIC用端子の最外部に位置するIC用端子の外側には、前記第1のピッチよりも大きい第2のピッチでダミー端子が形成されており、

前記ダミー端子は、前記ICドライバと重畳していないことを特徴とする表示装置。

【請求項2】

前記ダミー端子は、前記異方性導電フィルムとも重畳していないことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。

【請求項3】

前記TFT基板には、第1の金属と、前記第1の金属上に設けられたキャップメタルと、前記キャップメタル上に設けられた絶縁膜と、前記絶縁膜上に設けられた金属酸化物膜とを有しており、

前記複数のIC用端子は、前記絶縁膜に設けられたスルーホールを介して、前記キャップメタルと前記金属酸化物膜とが接続しており、

前記ダミー端子は、前記絶縁膜に設けられたスルーホールを介して、前記TFT基板と前記金属酸化物膜とが接觸していることを特徴とする請求項1又は2に記載の表示装置。

【請求項4】

前記TFT基板には、第1の金属と、前記第1の金属上に設けられたキャップメタルと、前記キャップメタル上に設けられた絶縁膜と、前記絶縁膜上に設けられた金属酸化物膜とを有しており、

前記複数のIC用端子は、前記絶縁膜に設けられたスルーホールを介して、前記キャップメタルと前記金属酸化物膜とが接続しており、

プメタルと前記金属酸化物膜とが接続しており、

前記ダミー端子は、前記絶縁膜に設けられたスルーホールを介して、前記キャップメタルと前記金属酸化物とが接続しており、

前記複数の I C 用端子のキャップメタルに対して、前記ダミー端子のキャップメタルの方が薄膜化されていることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の表示装置。